



Vacuum Forum

일자 : 2013년 2월 1일(금)

시간 : 13:00 ~ 17:20

장소 : 코엑스, 컨퍼런스룸 317호

언어 : 한국어

등록비(Registration Fee)

	SEMI Member(회원)	Non-Member(비회원)
사전등록(1월 23일까지)	80,000 won	100,000 won
현장등록	100,000 won	120,000 won

진공 배기 시스템의 가동 조건이 반도체 소자와 OLED 를 포함한 평판디스플레이 제조 과정에 지장을 초래할 수도 있고 진공 배기 시스템의 문제는 사용자에게 많은 비용을 지불하게 하기 때문에 진공 기술이 이 제조 과정에 있어 중요한 요소들 가운데 하나임에도 불구하고 소자 제조업체들과 심지어 OEM 들 조차도 이를 간과해 왔다. 이 포럼에서는 진공 전문가들과 함께 다음과 같은 주제들을 논의하고자 한다.

- 반도체 소자와 평판디스플레이 공정들로 인한 진공 배기 시스템의 문제.
- 첨단 건식 진공 펌프 개발의 필요성과 OLED 그리고 차세대 반도체 메모리 제조에 필요한 진공 기술
- 진공 펌프의 에너지 절감 장치와 방법
- 진공 펌프 고장 방지를 위한 예지 진단

Co-organized by



Demands on Vacuum Expertise and Resource Information

13:00-13:30	진공 전문성과 진공 기술 인력에 대한 요구 - 한국표준과학연구원 진공센타 임종연 박사
	Impact of the Semiconductor/FPD Processes on Vacuum Pumping System
13:30-14:10	반도체/평판디스플레이 생산 공정이 진공 배기 시스템에 미치는 영향 – LOT Vacuum 노명근 박사
14:10-14:40	Energy Saving Method and Device for Vacuum Pumping System 진공 배기 시스템 에너지 절감 방안 – 에드워드 코리아 주장현 박사
14:40-15:10	Development Requirement on Advanced Dry Vacuum Pump 진보된 건식 진공 펌프의 개발 필요성 – 코디박 한영훈 박사
15:10-15:30	Break
15:30-16:10	Requirement of Vacuum Technology for OLED Manufacturing Process OLED 생산 공정에 필요한 진공 기술 – 한국알박 조우석 상무
16:10-16:40	Predictive Diagnostics for Dry Vacuum Pump 건식 진공 펌프 상태 진단 기술 – 한국표준과학연구원 정완섭 박사
16:40-17:20	The Process Issues in Current Memory Devices 메모리 소자들의 공정 문제점들 – SK-hynix 김완수 박사